**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa masek do fotolitografii do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją zawartą w pkt 3 poniżej.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa masek do fotolitografii:

* 6 szt. (sześć sztuk) masek 4″ do fotolitografii UV (365 nm),
* 1 szt. (jedna sztuka) maski 5” do fotolitografii DUV (250 nm).
1. **Parametry**

**3.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Podzespół | Parametr/Funkcja | Opis |
| 1 | **Parametry techniczne****maski 4”** **do fotolitografii UV (365nm)** | Geometria maski | Wymiar maski | 4” x 4” x 0,06” do 0,09” |
| Materiał | Soda Lime lub Syntetyczna krzemionka topiona |
| Warstwa maskująca | Materiał | Chrom |
| Gęstość optyczna | 3,0 +/- 0,3 @ 430nm |
| CD - Critical dimension - Wymiar krytyczny | Wymiar krytyczny | 1 µm |
| Format wzoru maski | Rodzaj pliku | “.dxf” |
| 2 | **Parametry techniczne****maski 5” do fotolitografii DUV (250nm)** | Geometria maski | Wymiar maski | 5” x 5” x 0,06” do 0,09” |
| Materiał | Kwarc |
| Warstwa maskująca | Materiał | Chrom |
| Gęstość optyczna | 2.8 +/- 0,3 @ 430nm |
| CD - Critical dimension - Wymiar krytyczny | Wymiar krytyczny | 0.6 µm |
| Format wzoru maski | Rodzaj pliku | “.dxf” |
| Ewaluacja maski | Proces testowy | Wykonanie 2 testowych procesów fotolitografii DUV na podłożach dostarczonych przez Zamawiającego i uzyskanie kształtów fotorezystu z dokładnością ± 0.1 µm względem przesłanego wzoru maski oraz pionowego lub negatywnego profilu rezystu. |